

Транспортные свойства топологических изоляторов Bi_2Te_3 и $\text{Bi}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ с р–п переходом

В.А. Голяшов^{1, 3 *}, К.А. Кох^{2, 3}, О.Е. Терещенко^{1, 3}

1 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090.

2 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, пр. ак. Коптюга, 3, Новосибирск, 630090.

3 Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090.

*vladimirgolyashov@gmail.com

На основании равновесной фазовой диаграммы и условий роста в модифицированном методе Бриджмена был предсказан и реализован встроенный р–п-переход в соединениях $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ и Bi_2Te_3 , механизм формирования которого связан с эффектом сегregation компонентов в процессе кристаллизации. Изменяя соотношение $\text{Bi}(\text{Sb})/\text{Te}$ в растворе–расплаве удалось получить р–п-переход в кристаллах с начальными составами расплавов $\text{Bi}_{1.9}\text{Te}_{3.1}$ и $\text{Bi}_{1.34}\text{Sb}_{0.66}\text{Te}_3$. Вблизи р–п-перехода наблюдалось наличие нескольких типов носителей. При этом в п-области кристалла $\text{Bi}_{1.9}\text{Te}_{3.1}$ холловская подвижность электронов достигала $\sim 70000 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ при концентрации $\sim 2\cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Обнаружено, что на поверхности (0001) как в р-, так и п-областях кристаллов формируется изгиб зон вниз, что может приводить к формированию двумерного электронного газа.

Введение

В последнее время активно изучаются материалы с сильным спин-орбитальным взаимодействием. Так, у ряда соединений V2VI3 и, в частности, Bi_2Sb_3 , Bi_2Te_3 и Bi_2Se_3 , были обнаружены свойства трехмерных топологических изоляторов (ТИ). В объеме эти материалы являются узкозонными полупроводниками с $E_g \sim 150\text{--}200 \text{ мэВ}$, но на их поверхности (0001) в запрещенной зоне существуют металлические поверхностные состояния с законом дисперсии, образующим конус Дирака. Поскольку носители заряда на таких поверхностных состояниях поляризованы по спину, то ТИ оказываются интересны в плане изучения в них спин-зависимых явлений и возможности их применения в устройствах спинtronики. Однако высокая концентрация свободных носителей в объеме, обусловленная большой плотностью дефектов кристаллической структуры, и, как следствие, закрепление уровня Ферми в разрешенных зонах и сильное шунтирующее действие объема не позволяют выделить поверхностные состояния в транспортных измерениях. В данной работе для решения этой проблемы рассматривается возможность управления уровнем Ферми в объеме и на поверхности ТИ путем создания р–п-перехода в объеме ТИ.

Так, известно, что тип проводимости Bi_2Te_3 определяется наличием антиструктурных дефектов Bi_{Te} (р-тип) и Te_{Bi} (п-тип), и кристаллы, выращенные из

расплавов с содержанием $\text{Te} > 63\%$ всегда имеют электронную проводимость, а меньше 60% — дырочную проводимость. На основании равновесной фазовой диаграммы и условий роста кристаллов Bi_2Te_3 из нестехиометрических расплавов (60–63% Te) модифицированным вертикальным методом Бриджмена можно реализовать р–п-переход в направлении роста кристалла, механизм формирования которого связан с эффектом сегregation компонентов в процессе роста и изменения состава ростового расплава [1].

В работе изучались кристаллы, выращенные модифицированным вертикальным методом Бриджмена из расплавов со стехиометрическими составами $\text{Bi}_{1.9}\text{Te}_{3.1}$ и $\text{Bi}_{1.34}\text{Sb}_{0.66}\text{Te}_3$. Были исследованы проводимость и эффект Холла в образцах, взятых в различных частях кристаллов вдоль оси роста. Также методом фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES) исследована электронная структура поверхности (0001) в различных областях кристаллов.

Результаты и обсуждение

На рис. 1(а) показаны распределения величин термоэДС и коэффициента Холла, измеренные вдоль оси роста кристалла $\text{Bi}_{1.9}\text{Te}_{3.1}$. Смена знаков коэффициента термо-ЭДС и постоянной Холла с положительных на отрицательные на расстоянии $\sim 40 \text{ мм}$ от начала кристалла указывают на смену типа проводимости с дырочной на электронную. При этом,